

ساخت شیشه‌های الکتروکرومیک با لایه اکسیدنیکل تهیه شده

یه روش لایه‌نشانی چرخشی و با دماهای یاز پخت متفاوت

ف زانه ضایع، سید محمد باقر قیشی

کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده کاشان

چکیده - در این پژوهش شیشه های الکتروکرومیک با لایه نازک اکسید نیکل با استفاده از روش لایه نشانی چرخشی طراحی و ساخته شده است. ساختار در نظر گرفته شده در این مقاله بدین شرح است: Glass/FTO/NiO/electrolyte/FTO/Glass که یک لایه نازک الکتروکرومیک (NiO) روی سه FTO به روش لایه نشانی چرخشی، لایه نشانی و سپس در سه دمای ۳۵۰، ۲۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتیگراد باز پخت شد. پس از آن با استفاده از سه FTO دیگر و تزريق الکتروولیت مایع، سلول های الکتروکرومیک ساخته شدند. با اعمال ولتاژ به سلول های ساخته شده، زمان، پاسخ و میزان عبور اندامه گردید و نتایج بدست آمده با هم مقایسه شدند.

کلید واژه: الکترومیک، اکسیدنیکا، لایه نشانی، حی خش، زمان، باسخ

Electrochromic windows with nickel oxide film design and fabrication provided by spin coating and with different anneal temperatures

Farzane rezaei, seyyed mohammad bagher ghoraiishi

Kashan, university of kashan, Department of Physics

In this study, electrochromic glasses with NiO thin film are fabricated with using spin-coating method. The structure of Glass / FTO / NiO / electrolyte / FTO /Glass is used in this paper. A thin film of NiO is deposited on three of FTO and annealed at temperatures of 250, 350 and 450°C. then the electrochromic cells are fabricated by three another FTO and the electrolyte is injected in them .The voltage is applied to the samples. The switching time and transmittance are measured and the results have been compared with together.

Keywords: electrochromic, nickel oxide, spin coating, switching time

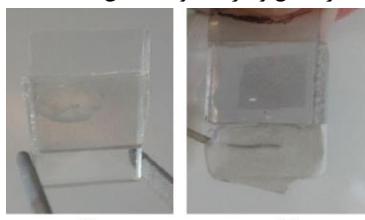
۳- ساخت سلول الکتروکرومیک

برای ساخت سلول الکتروکرومیک از دو شیشه رسانا (FTO) استفاده شده است که روی یکی از آنها همان طور که گفته شد اکسید نیکل لایه نشانی شده است و شیشه دیگر که روزنهای در آن به وسیله متة ایجاد شده، بدون لایه است. این دو به وسیله‌ی یک لایه پلیمری جدا کننده (اسپیسر) که مربعی به ابعاد ۱*۱ سانتی متر مربع از وسط آن جدا شده است، به هم چسبانده شدند. سپس در فضای خالی ایجاد شده بین آنها از طریق روزنه، الکتروولیت لیتیوم کلراید ۱ مولار تزریق شد. برای تزریق بهتر الکتروولیت، نمونه ساخته شده در خلاً گذاشته شد. برای جلوگیری از تبخیر الکتروولیت، روزنه با استفاده از چسبی که مخلوطی از دو ماده رزین اپوکسی و هاردنر است، بسته شد.



شکل ۱: تصویری از اسپیسر و FTO سوراخ شده

در شکل‌های ۲، ۳ و ۴ تصاویری از سلول‌های الکتروکرومیک ساخته شده قبل و بعد از اعمال ولتاژ ۳/۳ ولت، نشان داده شده است.



شکل ۲: (الف) سلول ساخته شده به روش لایه نشانی چرخشی با دمای بازپخت ۲۵۰ درجه سانتیگراد (بدون اعمال ولتاژ) (ب) سلول ساخته شده پس از اعمال ولتاژ ۳/۳ ولت



شکل ۳: (الف) سلول ساخته شده به روش لایه نشانی چرخشی با دمای بازپخت ۳۵۰ درجه سانتیگراد (بدون اعمال ولتاژ) (ب) سلول ساخته شده پس از اعمال ولتاژ ۳/۳ ولت



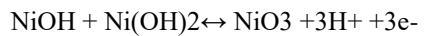
شکل ۴: (الف) سلول ساخته شده به روش لایه نشانی چرخشی با دمای بازپخت ۴۵۰ درجه سانتیگراد (بدون اعمال ولتاژ) (ب) سلول ساخته شده پس از اعمال ولتاژ ۳/۳ ولت

۱- مقدمه

یکی از موضوعات چالش برانگیز قرن جاری در سراسر جهان مسئله انرژی و جلوگیری از اتلاف آن است. پنجره ها مهم ترین جزء ساختمان در اتلاف انرژی محسوب می‌شوند. از این رو استفاده از شیشه‌های الکتروکرومیک که خود نوعی شیشه هوشمند محسوب می‌شوند کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی از طریق کاهش تقاضا جهت گرمایش، سرمایش و روشنایی داخل ساختمان می‌نماید [۱].

پدیده‌های الکتروکرومیک درواقع شامل تعییرات برگشت پذیر در خواص نوری (شفافیت، جذب و تبلیغ) یک ماده، ناشی از اعمال یک میدان یا جریان الکتریکی و حاصل یک واکنش اکسایش- کاهش است [۲]. این واکنش از طریق رابطه زیر که برای اکسید نیکل نوشته

رخ می‌دهد:



اکسید فلزهای واسطه استفاده‌های مختلفی در دستگاه‌هایی مثل باتری‌ها، سلول‌های الکتروشیمیایی، شیشه‌های الکتروکرومیک، کاتالیزگرهای و سنسورها دارند [۳].

مواد الکتروکرومیک غیرآلی شامل NbO ، NiO ، WO_3 ، MoO_3 و ... مورد توجه قرار گرفته اند [۴] که بخشی از آنها به عنوان مواد کاتدی رنگی (رنگی شده در حالت کاهیده) شامل NiO و بخش دیگر آنها به عنوان مواد آندی رنگی (رنگی شده در حالت اکسایش) شامل WO_3 بررسی شده اند [۵].

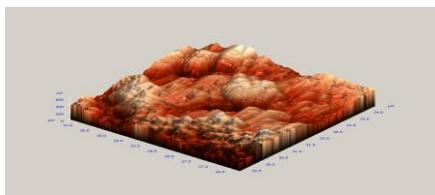
اکسید نیکل در حالت بدون اعمال ولتاژ بی رنگ و در حالت اعمال ولتاژ قهوه‌ای تیره است [۶].

روش‌های مختلفی برای لایه‌نشانی NiO وجود دارد که شامل لایه نشانی چرخشی، غوطه‌وری و تبخیری حرارتی است.

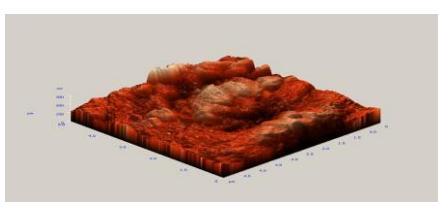
۲- روش و مواد آزمایش

به منظور تهیه محلول اکسید نیکل، ابتدا نیکل استات ۰/۵ مولار در ۱۰ میلی لیتر متوكسی اتانول حل شده و سپس ۰/۳ میلی لیتر مونو اتانول آمین به آن اضافه شد و به مدت یک ساعت بوسیله همزن مغناطیسی هم زده شد. به منظور ساخت نمونه‌ها، شیشه‌ها دارای لایه

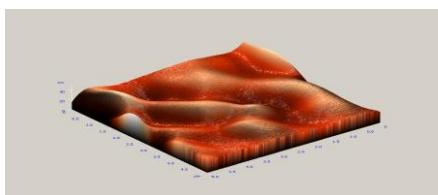
$15 \times 25 \text{ mm}^2$ به مساحت با شوینده، آب مقطر، پروپانول، استون آزمایشگاهی و بار دیگر آب مقطار در حمام فراصوتی هر کدام به مدت ۱۰ دقیقه شستشو داده شدند و در نهایت در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه خشک شدند. با استفاده از دستگاه لایه‌نشانی چرخشی با سرعت ۳۶۰۰ دور بر ثانیه و به مدت ۳۰ ثانیه برای سه بار روی سه FTO که قبلاً شسته شده بودند، لایه نشانی انجام شد. سپس این زیر لایه‌ها در دمای ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ دقیقه بازپخت شدند. با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج سوزنی (DSTG) با surface profilometer سوزنی و با دقت ۱۰ نانومتر، ضخامت لایه اندازه‌گیری شد که مقدار آن ۳۰۰ نانومتر بدست آمد. سپس سه FTO دیگر به منظور تزریق الکتروولیت با منته به قطر ۷/۰ میلی‌متر سوراخ گردیدند.



شکل ۷: تصویر AFM گرفته شده از نمونه لایه نشانی شده به روش چرخشی و با دمای بازپخت ۲۵۰ درجه سانتی گراد



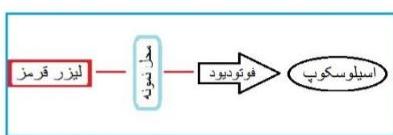
شکل ۸: تصویر AFM گرفته شده از نمونه لایه نشانی شده به روش چرخشی و با دمای بازپخت ۳۵۰ درجه سانتی گراد



شکل ۹: تصویر AFM گرفته شده از نمونه لایه نشانی شده به روش چرخشی و با دمای بازپخت ۴۵۰ درجه سانتی گراد

۴-۴- زمان پاسخ:

مدت زمان رنگ شدن و بی‌رنگ شدن نمونه را زمان پاسخ می‌گویند که با استفاده از دستگاه آنالیز شامل فوتودیود، لیزر و اسیلوسکوپ برای نمونه‌ها اندازه‌گیری شد که در شکل ۱۰ نمای شماتیکی آن مشاهده می‌شود.



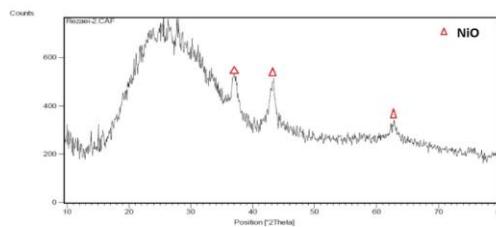
شکل ۱۰: نمای شماتیک از دستگاه آنالیزور

برای تعیین زمان پاسخ نمونه، ۷۰ درصد تغییرات عبور که اختلاف بین زمان کمینه و بیشینه‌ی ولتاژ در نمودار ولتاژ-زمان است، محاسبه شد. نمودارهای ولتاژ-زمان در شکل‌های ۱۱ و ۱۲ مشاهده می‌شوند.

۴-۴- اندازه‌گیری سلول‌های ساخته شده

۴-۱- آنالیز XRD:

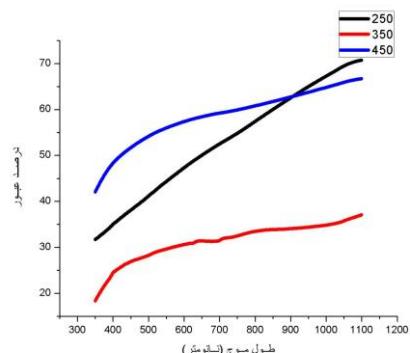
محلول سنتز شده FTO بر روی NiO لایه نشانی شد و از آن آنالیز XRD گرفته شد که با توجه به شکل ۵ مشاهده می‌شود که ماده اکسید نیکل لایه نشانی شده دارای سه پیک برجسته است که این پیک‌ها مطابق الگوی اصلی بوده و درنتیجه سنتز به درستی انجام شده است.



شکل ۵: نمودار XRD از ماده اکسید نیکل سنتز شده

۴-۲- طیف عبور:

طیف عبور با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری دو پرتویی برای گستره طول موجی ۳۶۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر و با گام ۱ نانومتر بدست آمده است. در شکل ۶ میزان عبور از لایه اکسید نیکل لایه نشانی شده بر روی FTO و با دمای‌های بازپخت ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتیگراد بر حسب طول موج نشان داده شده است.



شکل ۶: نمودار تغییرات عبور از لایه اکسید نیکل لایه نشانی شده بر روی FTO و با دمای‌های بازپخت ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتی گراد

۴-۳- آنالیز ریخت شناسی سطحی (AFM):

همان‌طور که در شکل‌های ۷، ۸ و ۹ مشاهده می‌شود از لایه اکسید نیکل با دمای‌های بازپخت ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتی گراد آنالیز AFM گرفته شد که میانگین پستی و بلندی لایه‌ها به ترتیب ۷۰، ۲۸ و ۵ نانومتر است. در نتیجه، بالا رفتن دمای بازپخت باعث یکنواخت‌تر شدن سطح لایه شده است.

با ساختار Glass/FTO/NiO/electrolyte/FTO/Glass

نتایج قابل توجهی به دست آمد.

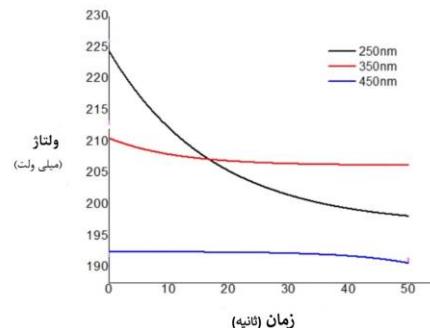
نتایج نشان می دهد زمان پاسخ به دست آمده برای سلولی که لایه اکسید نیکل آن در دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد بازپخت شده است، از مقادیر کمتری برخوردار بوده است. در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد مقادیر زمان پاسخ ناچیز بود و همچنین طبق شکل ۴ تغییر رنگ محسوسی در آن مشاهده نشد و این به معنی آن است که سلول ساخته شده با این دمای بازپخت سلول مطلوبی نیست.

۵- نتیجه‌گیری

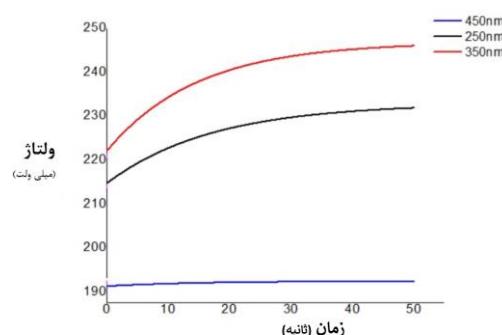
باتوجه به اینکه سلول ساخته شده به روش چرخشی با دمای بازپخت ۳۵۰ درجه سانتی گراد زمان پاسخ کمتری نسبت به دیگر سلول های ساخته شده با دماهای بازپخت ۲۵۰ درجه سانتی گراد دارد و همچنین مطلوب نبودن سلول ساخته شده با دمای بازپخت ۴۵۰ درجه سانتی گراد، میتوان گفت که دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد به عنوان دمای بهینه برای لایه نشانی به روش چرخشی پیشنهاد می‌شود.

۶- منابع

- [1] L. M. Bertus, C. Faure, a. Danine, C. Labrugere, G. Campet, a. Rougier, and a. Duta, "Synthesis and characterization of WO₃ thin films by surfactant assisted spray pyrolysis for electrochromic applications," Mater. Chem. Phys., vol. 140, no. 1, pp. 49–59, 2013.
- [2] S. K. Deb, "Photovoltaic-Integrated Electrochromic Device for Smart-Window Applications Preprint," no. May, 2000.
- [3] P.M.S Monk, R.J Mortimer, D.R. Rossenky, Electrochromism: Fundamentals and applications (1995) Weinheim, VCH.
- [4] Granqvist, C. G. (Ed.). (1995). Handbook of inorganic electrochromic materials. Elsevier.
- [5] Moulki, H., Park, D. H., Min, B. K., Kwon, H., Hwang, S. J., Choy, J. H., ... & Rougier, A. (2012). Improved electrochromic performances of NiO based thin films by lithium addition: from single layers to devices. *Electrochimica Acta*, 74, 46-52.
- [6] Pang, Y., Chen, Q., Shen, X., Tang, L., & Qian, H. (2010). Sizecontrolled Ag nanoparticle modified WO₃ composite films for adjustment of electrochromic properties. *Thin Solid Films*, 518(8), 1920-1924.



شکل ۱۱: نمودار زمان پاسخ سلول های الکتروکرومیک ساخته شده به روش چرخشی و با دماهای بازپخت ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتی گراد در حالت تیره شدن



شکل ۱۲: نمودار زمان پاسخ سلول های الکتروکرومیک ساخته شده به روش چرخشی و با دماهای بازپخت ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتی گراد در حالت شفاف شدن

مقایسه سلول های ساخته شده با دماهای بازپخت متفاوت و با اعمال ولتاژ $\frac{2}{3}$ در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱: زمان پاسخ سلول های الکتروکرومیک ساخته شده به روش چرخشی و با دماهای بازپخت ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتی گراد

	زمان پاسخ در حالت تیره شدن (ثانیه)	زمان پاسخ در حالت شفاف شدن (ثانیه)
اکسیدنیکل لایه - نشانی شده با دمای بازپخت ۲۵۰°C	۳,۷۰	۱۹,۶۰
اکسیدنیکل لایه - نشانی شده با دمای بازپخت ۳۵۰°C	۱,۱۷	۱۵,۷
اکسیدنیکل لایه - نشانی شده با دمای بازپخت ۴۵۰°C	۰,۰۶	۰,۰۲

با آنالیز نمونه های ساخته شده با اکسید نیکل به روش لایه نشانی چرخشی و با دماهای بازپخت ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتی گراد و